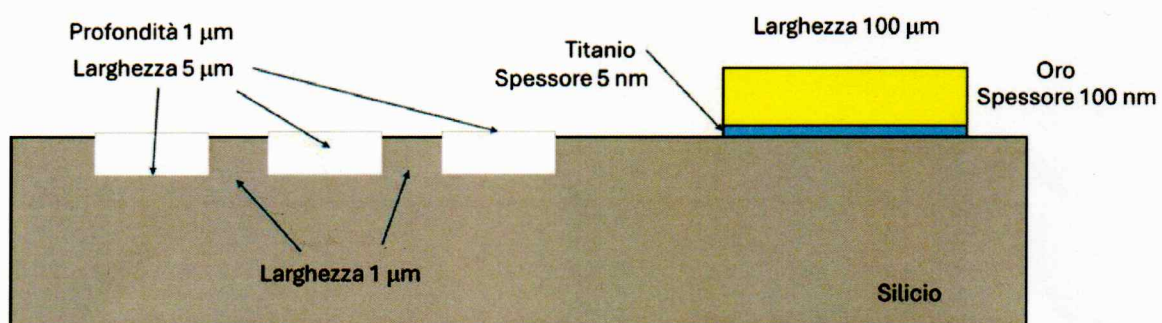


BANDO N. 1/2024/TD/CTER- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 36 (trentasei) mesi, di n. 2 unità di personale di VI livello, profilo professionale Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER)

TRACCIA N. 2

Si consideri la struttura rappresentata qui sotto in sezione. Le componenti della sezione NON sono in scala.

1. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica litografica che può essere utilizzata per ottenere le cave nel silicio. Le dimensioni sono: larghezza delle cave $5\ \mu\text{m}$, distanza tra le cave $1\ \mu\text{m}$, lunghezza $200\ \mu\text{m}$ (non mostrata in sezione).
2. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica di deposizione dello strato metallico in oro che deve avere uno spessore di $100\ \text{nm}$.
3. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica di etching per ottenere le cave nel silicio (wafer con orientazione $\langle 111 \rangle$) aventi profondità pari a $1\ \mu\text{m}$.
4. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica o le tecniche di caratterizzazione per verificare che l'etching delle cave ottenuto corrisponda alla struttura desiderata.



cg CF R2 Cn